

<https://www.spst-photopolymer.org>

Call for Papers

ICPST-39

The 39th International Conference
of
Photopolymer Science
and
Technology

Materials & Processes
for
Advanced Lithography,
Nanotechnology and Phototechnology

June 27 - 30, 2022

**International Conference Hall
Makuhari Messe, Chiba, Japan
or
On-line Meeting**

**Sponsored by the Society of Photopolymer
Science and Technology (SPST)**

In Cooperation with
The Technical Association of
Photopolymers, Japan
The Chemical Society of Japan
The Society of Polymer Science, Japan
Endorsed by
The Japan Society of Applied Physics
(Tentative)

Introduction

The 39th International Conference of Photopolymer Science and Technology, Materials & Processes for Advanced Lithography, Nanotechnology and Phototechnology (**ICPST-39**) organized by **SPST** will be held at International Conference Hall, Makuhari Messe, Chiba, Japan on June 27-30, 2022. COVID-19 pandemic may change **ICPST-39** to an on-line meeting. The details will appear at the SPST Homepage. All the contributors of papers on the scientific progress and the technical development of photopolymers are cordially invited.

Scopes

The conference covers a wide range of topics relevant to photopolymer science and technology in the following fields:

A. English Symposia

- A1. Next Generation Lithography, EB Lithography and Nanotechnology
- A2. Nanobiotechnology
- A3. Directed Self Assembly (DSA)
- A4. Computational / Analytical Approach for Lithography Processes
- A5. EUV Lithography
- A6. Nanoimprint
- A7. 193 nm Lithography Extension and EUV HVM Readiness
- A8. Photopolymers in 3-D Printing/ Additive Manufacturing
- A9. 2D and Stimuli Responsive Materials for Electronics & Photonics
- A10. Strategies and Materials for Advanced Packaging, Next Generation MEMS, Flexible Devices
- A11. Chemistry for Advanced Photopolymer Science
- A12. Organic and Hybrid Materials for Photovoltaic and Optoelectronic Devices
- A13. Fundamentals and Applications of Biomimetics Materials and Processes
- A14. General Scopes of Photopolymer Science and Technology
- P. Panel Symposium "Beyond Sub-10 nm Lithography -From a Material Design and Development Perspective-

B. Japanese Symposia

- B1. Polyimides and High Thermally Stable Resins
-Functionalization and Practical Applications-
- B2. Plasma Photochemistry and Functionalization of Polymer Surfaces
- B3. General Scopes of Photopolymer Science and Technology

Language and Oral Presentation Time

English is used for presentations in English Symposia and Panel Symposium. Japanese and English are used for presentations in Japanese Symposia. Each presentation will not be longer than 20 minutes including discussion except for the notified lectures.

Application to Scientific Program

Apply to [Conference → Presentation-Information Submission] at the SPST Homepage (<https://www.spst-photopolymer.org/>) before **February 14, 2022**.

Editorial Office

Assoc. Prof. Hiroyuki Mayama
Journal of Photopolymer Science and Technology,
Department of Chemistry, Asahikawa Medical University, 2-1-1 Midorigaoka-higashi,
Asahikawa 078-8510, Japan
Phone: +81-166-68-2726 Fax: +81-166-68-2782
E-mail: mayama@asahikawa-med.ac.jp

Papers

Papers submitted to ICPST-39 are published in Journal of Photopolymer Science and Technology, Vol. 35 (2022) after reviewing on the Journal's standard. Journal will be distributed to each participant during the conference. Preparation of manuscripts for the Journal should be followed to "Instructions to Authors" and "Manual for Manuscript Writing". Refer "Page Layout Sample" and use "Sample Manuscript (Manuscript Template)". Submit the manuscripts to [Journal → Submission & Reviewing of MS] at the SPST Homepage before **April 1, 2022**. The Journal will be published and mailed before ICPST-39.

Registration for Participants

All the participants including speakers are requested to register in [Conference → Registration] at the SPST Homepage before **May 25, 2022**.

Conference Office

The 39th International Conference of Photopolymer Science and Technology (ICPST-39)
c/o Prof. Takashi Karatsu
Department of Applied Chemistry
Chiba University
1-33 Yayoicho, Inage, Chiba 263-8522, Japan
Phone: +81-43-290-3366 Fax: +81-43-290-3401
E-mail office@spst-photopolymer.org

The Society of Photopolymer Science and Technology (SPST)

President: Minoru Tsuda
Director of Administration: Takashi Karatsu
Director of Scientific Program: Masayuki Endo
Director of Publication: Hiroyuki Mayama
Director of International Affairs: Takeo Watanabe
Director: Hiroto Kudo

ICPST-39 International Advisory Board

ICPST-39 Organizing Committee

Chairperson: Minoru Tsuda

Members: R. Allen, H. Araki, T. Azuma, M. Endo, T. Hayakawa, Y. Hirai, T. Hirano, T. Hirayama, H. Horibe, T. Ichiki, T. Karatsu, Y. Kawai, S. Kondo, H. Kudo, M. Kuzuya, H. Mayama, J. Mizuno, T. Murosaki, S. Nagahara, T. Nagai, H. Ohkita, H. Oizumi, H. Okamura, I. Osaka, S. Seki, A. Sekiguchi, T. Seshimo, A. Shibuya, K. Soga, J. Taniguchi, K. Takei, T. Ueno, T. Watanabe, T. Yamashita, W. Yueh

ICPST-39 Program Committee, Chairperson: Masayuki Endo

Local Committee, Chairperson: Takashi Karatsu

<https://www.spst-photopolymer.org>

講演募集

ICPST-39

第39回 国際フォトポリマーコンファレンス

リソグラフィー、ナノテクノロジー、
フォトテクノロジー
-材料とプロセスの最前線-

2022年6月27日（月）～30日（木）

幕張メッセ国際会議場
または
オンライン開催

主催 フォトポリマー学会（SPST）

協賛（交渉中）フォトポリマー懇話会、
日本化学会、高分子学会
後援（交渉中）応用物理学会

第39回国際フォトポリマーコンファレンスを下記の要領で開催いたします。
フォトポリマーに関心をお持ちの方々は是非、御参加下さい。

日 時 2022年6月27日（月）～30日（木）

会 場 千葉市美浜区中瀬2-1
幕張メッセ国際会議場（JR海浜幕張下車徒歩5分）
新型コロナウイルスの影響が懸念される際はオンライン開催と
なります。
詳細は学会ホームページでご案内します。

講演内容

フォトポリマーに関する科学と技術の研究報告

A. 英語シンポジウム

- A1. Next Generation Lithography, EB Lithography and Nanotechnology
- A2. Nanobiotechnology
- A3. Directed Self Assembly (DSA)
- A4. Computational / Analytical Approach for Lithography Processes
- A5. EUV Lithography
- A6. Nanoimprint
- A7. 193 nm Lithography Extension and EUV HVM Readiness
- A8. Photopolymers in 3-D Printing/ Additive Manufacturing
- A9. 2D and Stimuli Responsive Materials for Electronics & Photonics
- A10. Strategies and Materials for Advanced Packaging, Next Generation MEMS, Flexible Devices
- A11. Chemistry for Advanced Photopolymer Science
- A12. Organic and Hybrid Materials for Photovoltaic and Optoelectronic Devices
- A13. Fundamentals and Applications of Biomimetics Materials and Processes
- A14. General Scopes of Photopolymer Science and Technology
- P. Panel Symposium "Beyond Sub-10 nm Lithography -From a Material Design and Development Perspective-"

B. 日本語シンポジウム

- B1. ポリイミド及び高温耐熱樹脂-機能化と応用
- B2. プラズマ光化学と高分子表面機能化
- B3. 一般講演：(1) 光物質化学の基礎（光物理過程、光化学反応など）、
(2) 光機能素子材料（分子メモリー、情報記録材料、液晶など）、
(3) 光・レーザー電子線を活用する合成・重合・パターンニング、
(4) フォトファブリケーション（光成型プロセス、リソグラフィ）、
(5) レジスト除去、エッチング、洗浄、(6) 装置（光源、照射装置、計測、
プロセスなど）

講演時間と言語

原則として討論時間を含め20分。英語シンポジウムは英語、日本語シンポジウムは日本語及び英語

講演申込

学会ホームページ (<https://www.spst-photopolymer.org/>) [講演募集ICPST-39→日本語会場発表申し込み]から申し込んでください。

申込締切 2022年2月14日（月）

論文の出版

ICPST-39の論文はJournal of Photopolymer Science and Technology Vol. 35 (2022) にJournal基準による審査を経て出版されます。論文原稿は、完全原稿を作成し、2022年4月1日(金)までに学会ホームページ(<https://www.spst-photopolymer.org/>)の [Journal→Submission&Reviewing of MS] に投稿してください。

フोटポリマー学会出版局

〒078-8510 北海道旭川市緑が丘東2条1丁目1-1
旭川医科大学 一般教育 化学教室 眞山博幸
Tel: 0166-68-2726, Fax: 0166-68-2782
E-mail: mayama@asahikawa-med.ac.jp

参加申込予約締切 2022年5月25日(水)

参加登録方法

講演者を含む全参加者はフोटポリマー学会のホームページ(<https://www.spst-photopolymer.org/>講演募集icpst-39-2022/参加登録/)より登録ください。

展示会

コンファレンス期間中展示会を併設します。展示会出展企業を募集いたします。事務局に申し込みまたはお問い合わせ下さい。

第39回 国際フोटポリマーコンファレンス事務局

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33
千葉大学工学研究院共生応用化学コース 唐津 孝
Tel 043-290-3366, Fax 043-290-3401
E-mail: office@spst-photopolymer.org

フोटポリマー学会 (SPST)

会長： 津田 穰
出版局長： 眞山博幸
企画局長： 遠藤政孝
事務局長： 唐津 孝
国際局長： 渡邊健夫
理事： 工藤 宏人
ICPST-39国際諮問委員会

ICPST-39組織委員会

委員長：津田 穰
委員：東 司、荒木 斉、一木隆範、上野 巧、遠藤政孝、老泉博昭、大北英生、岡村晴之、尾坂 格、唐津 孝、河合義夫、工藤宏人、葛谷昌之、近藤伸一、渋谷明規、関 修平、関口 淳、瀬下武弘、曾我公平、竹井邦晴、谷口 淳、永井智樹、永原誠司、早川晃鏡、平井義彦、平野 孝、平山 拓、堀邊英夫、眞山博幸、水野 潤、室崎 喬之、山下 俊、渡邊健夫、Robert Allen、Wang Yueh

ICPST-39企画委員会 委員長：遠藤政孝
現地実行委員会 委員長：唐津 孝